

■改革なくして成長なし？！

ロデール・ニッタ(株) 寺崎忠

1980年代、日本は世界の半導体市場で約40%のシェアを誇っていた時期であります。
「Japan as No.1」や「日本の経営に学べ」という風潮の時期と記憶します。
(いまやどういふ計算方法が分かりませんが、日本の競争力は世界第30位とのことで、
隔世の感があります)

アメリカでは日本の躍進に危機感を持ち、SEMATECHを設立し挽回を図った時期であり、
CMPプロセスの発表がありCMPの量産化への移行が進んで行った時期であります。

そういう時期、Rodel Inc. より弊社にCMP技術、CMP市場展望などの話があり、
弊社はそれまでのUSAからの情報入手レベルから日本国内へのCMP消耗資材の
本格的拡販活動へ移行しました。弊社内にプラナリゼーションチームを設置したのは
今からちょうど10年前のことです。(1992年2月)

当時、日本の半導体メーカー各社も研究所や技術部門でCMPの研究を(密かに?!)されていたと
思いますが、半導体プロセス関係のセミナーやシンポジウムでは、

「あんな汚いプロセスを半導体プロセスとして本当に使えるの？」
「あんな原理も分からない不安定な芸術的プロセスを量産技術として使えるの？」
「アメリカはいい加減だからできるんじゃないの？」

とかという表向き(?)のCMPへの否定的発言が結構支配的でありました。
CMPという新技術の勃興期で非常に楽しい反面、USAと異なり日本ではCMPに対して
逆風が吹いているなあと、途方に暮れる時期でもありました。
また、USAではIP(Intellectual Property)にエネルギーを注いで
技術の権利化を図っていた時期でもあります。
現在、Defact StandardになっているRodel Inc.のCMP製品も
この時期に開発され出願されたものです。

画期的技術なら多少の問題は目をつぶり(あるいは解決策を見出し)実用化に向け
積極的にチャレンジするという開拓精神を持ったUSAと、
他方、現象が理解され納得できるレベルになるまで(あるいはどこかで実績が充分積まれるまで)
待つという農耕民族的(保守的)思考を持った日本との相違を感じました。

その状況を打開するため、ある半導体メーカーのTopのアドバイスをもとに
弊社がCMPのセミナーを主催し、日本のみならず世界の各社研究者・技術者の方々に
CMP技術の討議の場を提供することを考えました。
一企業の宣伝ではなく、純粋にCMP技術について研究されている方々に参集頂き
自由な討議を通じてCMP技術の日本での普及を図れればと企画しました。1994年のことです。
日本国内では早くから先導的にCMP技術の研究を展開していた埼玉大学・土肥教授(本委員会・
委員長)には、この趣旨にご賛同頂きモデレータを務めていただきました。写真はその一幕です。



その後のCMPプロセスの発展はご承知のとおりです。
(セミナーの主目的ではありませんでしたが、お蔭様で弊社の売上もそれを期に大きく伸びました。)

一方10年前にCMPに従事していた我々のUSAの同僚は殆どいなくなり、今は新たなメンバーで行われております。こちら(人の異動、変化)もどうも開拓精神がベースなのでしょうか、どんどん変わります。当初、こういうUSAの傾向に対し私ははなはだ懐疑的で、如何にして機密を保持できるか? 如何にして本人および組織のレベルアップが図れるか? などと考えておりましたが軍事力、政治に限らず、経済でもUSAは世界の頂点にいる訳で、何やら彼らの仕組みの方が着実な好結果を得ている事実に驚いています。やはり、変革、チャレンジが進歩、成長に繋がるというUSA的思考と現状の延長線上でスキル・レベルアップを図るという従来の日本的思考との相違を意識せざるを得ません。

今月より私の上司はUSA人となります。
以上の私の独断と偏見が正しいものか否かの検証を含め新たな挑戦を密かに楽しみにしております。
願わくば、従来型CMPに替わる次世代技術はこの日本の農耕民族から産まれることを祈念しながら!

次は荏原製作所 精密・電子事業本部の辻村副本部長にお願い致します。
辻村さん、よろしくお願い致します。